

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第2区分
 【発行日】平成17年4月7日(2005.4.7)

【公開番号】特開2003-207885(P2003-207885A)

【公開日】平成15年7月25日(2003.7.25)

【出願番号】特願2002-3899(P2002-3899)

【国際特許分類第7版】

G 03 F 7/004

C 07 C 25/02

C 07 C 381/12

G 03 F 7/039

H 01 L 21/027

【F I】

G 03 F 7/004 503 A

G 03 F 7/004 501

C 07 C 25/02

C 07 C 381/12

G 03 F 7/039 601

H 01 L 21/30 502 R

【手続補正書】

【提出日】平成16年5月27日(2004.5.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(A) 活性光線又は放射線の照射により、少なくとも1つのフッ素原子及び/又は少なくとも1つのフッ素原子を有する基で置換された芳香族スルホン酸を発生する化合物少なくとも1種、

(B) 単環又は多環の脂環炭化水素構造を有し、酸の作用により分解し、アルカリ現像液中の溶解度が増大する樹脂

(C) 少なくとも3つ以上の水酸基又は置換された水酸基を有し、かつ少なくとも一つの環状構造を有する化合物

を含有することを特徴とするポジ型感光性組成物。

【請求項2】

請求項1に記載のポジ型感光性組成物により膜を形成し、当該膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。